Таким образом, в исследуемых образцах имеются ионы Ті³⁺, концентрация которых увеличивается при восстановлении оксида. Связанное с этими ионами наличие свободных электронов обусловливает максимальную электропроводность образца А1 и наименьшую фотоустойчивость. Введенные примеси снижают электропроводность и увеличивают фотоустойчивость, что говорит (согласно литературным данным) о связи фотоустойчивости с наличисм свободных зарядов в оксиде. Изменение фотоустойчивости коррелирует и с величиной α (см. таблицу), характеризующей наличие связанных зарядов. Эти заряды могут быть обусловлены наличием воды на поверхности оксида. На различных модификациях TiO₂ вода адсорбируется по-разному. В отличие от рутила активные центры анатаза имеют неоднородные энергетические характеристики, вода слабо связана с поверхностью анатаза (энергия связи поверхностью анатаза 14 ккал/моль, рутила воды с равна 25,5 ккал/моль) [10]. Выполненные нами исследования образцов А1 и А2 методом дериватографии показали, что введение примесей приводит к упрочению связи воды с поверхностью.

По данным работы [11], вода повышает работу выхода диоксида титана при температуре до 403 К, отрицательно заряжая поверхность. Такие локальные заряженные центры, которые обусловливают $\sigma = \omega \varepsilon''$, могут наряду с действием свободных электронов ухудшать фотоустойчивость пигмента.

- Модельное модифицирование рутила окислами алюминия и титана «мокрым спо-собом» / Т. А. Ермолаева, А. А. Исирикян, М. Л. Потанова, Е. В. Ушакова.— Ла-кокрасочные материалы и их применение, 1967, № 1, с. 23—25.
 Памфилов А. В., Бондарь П. Г., Мазуркевич Я. С. Влияние модифицирования на работу выхода из двуокиси титана.— Укр. хим. журн., 1965, 31, № 8, с. 768—771.
 Фигуровская Е. Н., Киселев В. Ф. Исследование обратимых и необратимых изме-исторования изме-исторовская.
- Фигуровская Е. П., Киселев В. Ф. Исследование обратимых и необратимых изменений работы выхода и электропроводности двуокиси титана при хемосорбции кислорода. Докл. АН СССР, 1967, 175, № 6, с. 1336—1339.
 О механизме хемосорбции воды на TiO₂/K. Хауффе, Е. А. Хассан, Х. Равелинг, Д.Райн. Журн. физ. химии, 1978, 52, № 2, с. 3058—3062.
 Volodin A. M., Cherkashin A. E., Zakharenko V. S. Influence of physically adsorbed oxygen on the separation of electron hole pairs on anatase irradiated by visible light. React. kinet. catal. Lett., 1979, 11, N 2, р. 103—106.
 Зависимость электропроводности легиоравной ликочиси ликоча.

- VISIDIE підпі.— React. кіпеі. сатаї. Lett., 1979, 11, № 2, р. 103—106.
 Зависимость электропроводности легированной двуокиси титана от состава и способа получения / Г. М. Козуб, В. И. Зарко, Л. С. Антонова, В. В. Павлов.— Укр. хим. журн., 1982, 48, № 8, с. 827—830.
 Хиппель А. Р. Диэлектрики и волны.— М.: Изд-во иностр. лит., 1960.—434 с.
 Кофстад П. Отклонение от стехнометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов.— М.: Мир, 1975.—396 с.
 Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия.— Там же, 1969.— Т. 2, 502 с.

- Т. З. 592 с.
- Carriosa J., Moreno F., Munuera G. Estudio comparativo de la adsorcion de vapor de aquasobre las variedadas anatasa y rutilo del TiO₂.— An. Real. Soc. Esp. Fisika y Quimica, 1971, 57, N 11, p. 919—924.
 Памфилов А. В., Бондарь П. Г., Мазуркевич Я. С. Влияние адсорбщии кислорода
- и паров воды на работу выхода электропроводности из двуокиси титана.-- Укр. хим. журн., 1965, 31, № 1, с. 48-53.

Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР, Киев Поступила 30.11.82

УДК 536.42

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ **ПРОЦЕССА** ОКИСЛЕНИЯ NiNb

В. Г. Чуприна

Соединение NiNb образуется по перетектической реакции при 1295° [1]. При 1100° оно гомогенно в интервале 50-54 ат. % Nb и согласно [2] имеет структуру типа W₆Fe₇. Ранее была изучена кинетика окисления NiNb на воздухе при 600-1000° (т=1-10 ч) [3]. В данной работе проведен послойный фазовый анализ окалин, образованных при этих режимах окисления.

Исследуемый сплав выплавляли в дуговой печи в среде аргона. Натяжением расплава в кварцевые трубки изготовляли столбики диаметром ~1 мм, которые гомогенизировали в вакуумной печи при 1000— 1050° в течение 100 ч. Химический, металлографический и рентгеноструктурный анализы полученных образцов свидетельствуют, что они эквиатомного состава, однофазные и беспористые. Периоды гексагональной решетки (типа W₆Fe₇) следующие: $a=4,888\pm0,002$ Å; $c=26,6\pm$ $\pm0,2$ Å, что согласуется с [2].

Послойный фазовый анализ окалин проводили по рентгенограммам, снятым с окисленного столбика NiNb, каждый раз после того, как с него мелкозернистой абразивной бумагой счищали тонкий слой ($\Delta d \sim 0,01$ мм) окалины. Съемку вели в камере типа Дебая с диаметром кассеты 150 мм, в медном нефильтрованном излучении. Как отмечалось в [4], литературные сообщения о рентгеновских отражениях окислов ниобия между собой часто не согласуются, порой бывают неполными. Поэтому в данном исследовании фазовый анализ сложных по составу окалин проводили по эталонным рентгенограммам, снятым с Ni, NiO, NiO·Nb₂O₅, α -Nb₂O₅, β -Nb₂O₅, NbO₂, NiNb и Ni₃Nb (табл. 1). Методы получения эталонных образцов, а также сопоставление их рентгеновских отражений с литературными приведены в [4].

Таблиц	(a 1										
Фазовый	состав	окалины.	образованной	на	NiNb	при	окислении	его	на	воздухе	

t, °C	τ, ч	Фазы				
600	1	NiO, $\alpha = Nb_2O_5$				
700	1 2	NiO, α=Nb ₂ O ₅ , Ni NiO, α=Nb ₂ O ₅ , Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ , Ni ₃ Nb				
800	10	NiO, $\alpha = Nb_2O_5$, Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , Ni ₃ Nb (следы)				
850	1 2 4 10	NiO, $\alpha = Nb_2O_5 \beta = Nb_2O_5$, Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ (следы), Ni ₃ Nb NiO, $\beta = Nb_2O_5$, Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ , Ni ₈ Nb NiO, $\beta = Nb_2O_5$, Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ , Ni ₃ Nb NiO, $\beta = Nb_2O_5$, Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ , Ni ₃ Nb				
900	1 10	NiO, α=Nb ₂ O ₅ , β=Nb ₂ O ₅ , Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ NbO ₂ (следы) Ni ₃ Nb NiO, β=Nb ₂ O ₅ , Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ , Ni ₃ Nb				
1000	1	NiO, β =Nb ₂ O ₅ , Ni, NiO·Nb ₂ O ₅ , NbO ₂ , Ni ₃ Nb				

В табл. 2 приведены результаты расчета двух рентгенограмм, снятых с окисленной исходной поверхности NiNb ($t=850^{\circ}$, $\tau=4$ ч) ($\Delta d=0$ мм) и после снятия слоя окалины ($\Delta d\approx 0,1$ мм). В ней помещены $\sin^2\theta$ (θ — брегговский угол отражения), относительные интенсивности I/I_0 , измеренные визуально по десятибалльной шкале и соответствующие им фазы. Индексы отражений для NbO₂ взяты из [5], NiO·Nb₂O₅ — [6], Ni₃Nb — [7], NiNb — из [2]. На рентгенограммах присутствуют не только линии фаз, расположенных на поверхности столбика, но и тех фаз, которые расположены глубже (с ослабленной интенсивностью).

Как видно из таблиц, в изучаемых окалинах найдены оксиды NiO, α -Nb₂O₅, β -Nb₂O₅, NiO·Nb₂O₅, NbO₂, а также Ni и Ni₃Nb, которые появляются в окалине при определенных режимах окисления и распределяются в ней по слоям. Оксид NiO обнаруживается на внешней поверхности окалины при всех исследуемых режимах окисления. Периоды его кубической решетки (тип NaCl) колеблются от a=4,165 Å до a==4,175 Å, NiO·Nb₂O₅ образуется в верхних слоях окалины при $t \ge 700^{\circ}$

Таблица 2 Расшифровка рентгенограмм, снятых со столбика NiNb, окисленного при 850° в течение 4 ч, до и после снятия слоя окалины

∆ <i>d</i> ==0 мм			∆ <i>d</i> ~0,1 мм					
sin²θ	I/I ₀	Фазы	sin²0	//I ₀	Фазы			
0 0490	7	B-Nh O	0 0490	1	B-NL O 101-NLO			
0,0429	4	$\beta = Nb_2O_5$ $\beta = Nb_2O_5$ $\beta = 0.31 - NiO \cdot Nb_2O_5$	0,0429 0 0461	1	β -Nb ₂ O ₅ , 101-NbO ₂ β -Nb ₂ O ₅			
0.0504	$\frac{1}{2}))$	B-Nb ₂ O ₂	0,0101	•	p 110205			
0,0001	_,,	P 110205	0,0513	4	400-NbO ₂			
0,0532	1	β-Nb ₂ O ₅						
0,0698	6	131-NiO·Nb ₂ O ₅	_					
0,0767	7ш	β -Nb ₂ O ₅ , 002-NiO·Nb ₂ O ₅	0,0763	4 ш	β-Nb ₂ O ₅ , 411-NbO ₂			
0,0816	1ш	β-Nb ₂ O ₅	0 0013	5	999-NbO			
0 0055	1	B-Nh O. 200-NiO. Nh O.	0,0313	5	222-11002			
0,0300	1	$109 \cdot NiO \cdot Nb_O$	0.0988	5	110-NiNb			
0.1030	3	111-NiO	0,0000	•				
0,.000	U		0,1064	1 ш	440,521-NbO ₂			
0,1116	3ш	β -Nb ₂ O ₅	•		, 2			
			0,1183	6 ш\)	402-NbO ₂ , 002-Ni ₃ Nb			
			0,1207	7ш))	201-Ni ₃ Nb 1.1.10-NiNb			
			0,1294	8	116-NiNb			
			0,1316	8	020-Ni ₃ Nb			
	_		0,1346	6	201-NiNb			
0,1369	5	β -Nb ₂ O ₅ , 200-NiO						
0,1407	4	$\beta \cdot ND_2O_5 231 \cdot NO \cdot ND_2O_5$	0,1407	1	β -Nb ₂ O ₅			
0,1444	9	1] 1 - N1	0,1446	4	111-Ni			
			0,1480	10	012-Ni ₃ ND			
			0,1524	5	$211-Ni_8ND, U25-ININD$			
0 1632	5	B-Nh-O 202-NiO Nh-O	0,1010	4	213-NBO ₂			
0,1002	0	p-110205, 202 1110 110205	0 1674	A	119-N;Nb			
			0 1738	5	207.NiNb			
0.1844	1ш	β -Nb ₂ O ₅ , 062-NiO·Nb ₂ O ₅	0,1858	ĩ	028-NINb			
0,1925	6	200-Ni, 232-NiO·Nb ₂ O ₅	0.1919	8	200-Ni, 622-NbO			
			0,2030	1	800-NbO ₂			
0,2094	2ш	β -Nb ₂ O ₅ , 162-NiO·Nb ₂ O ₅	0,2089	5	β -Nb ₂ O ₅ , NbO ₂			
0,2383	2ш	β -Nb ₂ O ₅ , 143-NiO·Nb ₂ O ₅	0,2378	4	β -Nb ₂ O ₅ , NbO ₂			
			0,2500	1	NbO ₂ , 022, 221-Ni ₃ Nb			
0,2735	2	220-NiO						
0,2803	1	β -Nb ₂ O ₅						
0,2876	2	302-NiO•Nb ₂ O ₅						
	•	⁰ NU - O	0,2937	1	NbO ₂			
0,3033	<u>з 2ш</u>	$p - N D_2 O_5$	0 0140		NLO			
0,3139	/ I > 1	104 NiO. Nb. O	0,3143	1	NDO ₂			
0,3190) 1	104-1010-100 ₂ 0 ₆	0 2210	1	0.1.10 N/Nb			
0 3474	L 1	B-Nh-O-	0,0012	1 9m	$\beta_{\rm N} = 0.16$			
0,3822	> 3	220-Ni	0,3833	2m 8	220_{-N}			
0,0022		220 111	0,3975	1	NiNh NhO.			
0.4100) 1	222-NiO	0,0070	-				
0,4353	3 1	β-Nb ₂ O ₅						
0,4428	31	β-Nb ₂ O ₅						
		-	0,4680	1	N bO ₂			
0,4716	61	432-NiO · Nb₂O₅						
	_		0,4813	2	402-Ni ₃ Nb			
0,4872	21	460-NiO · Nb ₂ O ₅						
0 70 1		000 N/O N/ O	0,4936	1	NbO ₂ , 014-Ni ₃ Nb			
0,504	1 1	293-N10 · Nb ₂ 05						
украі	инский	и химический журнал,	1983, т. 49	, № 10	3 - 3-612	1041		

Окончание табл. 2

<u>Δd=0</u> мм				Δ <i>d</i> ~0,1 MM				
sin²θ	1/1	Фазы	sin²θ	1/10	Фазы			
			0,5128	1	412-Ni _s Nb, NiNb			
0,5253	3	311-NI	0,5285	10ш	311-Ni, 040-Ni ₃ Nb			
0,5457	1	400-NiO						
0,5616	1	β-Nb ₂ O ₅						
0,5727	1	222-Ni	0,5705	4	222-Ni			
0,6148	1	NiO·Nb ₂ O ₅	•					
			0,6458	3ш	NiaNb			
0,6475	1	331-NiO	-		•			
0,6805	1	420-NiO						
0,6964	1	β-Nb ₂ O ₅ , NiO·Nb ₂ O ₅	0,6949	1	Ni ₃ Nb			
Прим	ечант	те.)) — Слияние линий; 1	ц — широки	ие лини	и.			

и тем раньше, чем выше температура окисления. Периоды его ромбической решетки: $a=5,013\pm0,007$ Å, $b=14,08\pm0,04$ Å, $c=5,68\pm0,03$ Å.

Пентаоксид ниобия располагается во внутренних слоях окалины. Низкотемпературная модификация α -Nb₂O₅ обнаруживается в окалине уже после одночасового окисления при 600°. Решетка α -Nb₂O₅ орторомбическая, $a=6,189\pm0,004$ Å, $b=3,670\pm0,006$ Å, $c=3,942\pm0,007$ Å. При $t \ge 800^\circ \alpha$ -Nb₂O₅ превращается в β -Nb₂O₅ (моноклинная решетка). В интервале 850—900° обнаруживаются обе модификации. При этом α -Nb₂O₅ располагается вблизи внутренней, а β -Nb₂O₅ — вблизи внешней границы окалины. Судя по их серому цвету и присутствию на рентгенограммах характерных «лишних» линий, они нестехиометричны.

Ni в окалине обнаруживается уже после 1 ч окисления при 700°. Период его решетки колеблется от a=3,519 Å до a=3,532 Å. Располагается он во внутренних слоях окалины в смеси с зернами пентаоксида ниобия. Под ними обнаруживается NbO₂ и Ni₃Nb. При высоких температурах ($t \ge 850^\circ$) вследствие значительных напряжений между слоями Ni+ β -Nb₂O₅ и NbO₂+Ni₃Nb намечается расслоение, где в заметном количестве скапливаются темно-фиолетовые зерна NbO₂, образуя рыхлую прослойку. По этой границе после охлаждения (при ударе) отслаивается окалина.

Ni и Ni₃Nb появляются в окалине вследствие преимущественного ухода ниобия в окалину, благодаря чему реализуются последовательные переходы NiNb→Ni₃Nb→Ni→NiO. На конечной стадии этого ряда происходит твердофазная реакция NiO+α (или β)-Nb₂O₅→NiO·Nb₂O₅.

При низких температурах, на начальных стадиях окисления ($t = 600-700^\circ$; $\tau = 1$ ч), вследствие свободного доступа кислорода к поверхности образца скорость ухода Nb в окалину настолько велика, что в ней наряду с оксидами никеля и ниобия обнаруживается Ni и не фиксируется Ni₃Nb. При 700° ($\tau \leq 1$ ч), когда линейное окисление сменяется параболическим [3], формируется сплошной слой NiO+NiO·Nb₂O₅, тормозящий диффузию кислорода.

Кинетические кривые свидетельствуют о замедлении окисления. На границе окалины со сплавом падает парциальное давление кислорода, появляется NbO₂ и Ni₃Nb. С повышением температуры до 800° процесс окисления активизируется и в окалине образуется настолько малое количество NbO₂ и Ni₃Nb, что на рентгенограммах иногда их линии отсутствуют.

При $t > 800^{\circ}$ происходит фазовое превращение $\alpha \rightarrow \beta = Nb_2O_5$, которое протекает в определенном временном и температурном интервале, когда в окалине присутствуют обе модификации, и сопровождается уменьшением и окисляемости NiNb [3], и толщины его окалины. Начинается оно тем раньше и протекает тем быстрее, чем выше темпера-

тура окисления. Аналогичное явление наблюдали при изучении окисления Nb [8] и Ni₃Nb [9].

Это явление обусловлено замедлением диффузии кислорода в зернах β-Nb₂O₅ и объясняется уменьшением числа кислородных вакансий в решетке β-Nb₂O₅ по сравнению с α-Nb₂O₅. Вероятно, здесь имеет место диффузионная перестройка решетки, сопровождаемая «залечиванием» кислородных вакансий. Поэтому в верхних слоях окалины, которые существуют при данной температуре более длительное время и лучше насыщаются кислородом, преобладают зерна β-Nb₂O₅, а вблизи границы со сплавом — а-Nb₂O₅. Уменьшение скорости окисления начинается после формирования определенной толщины слоя, содержащего β-Nb₂O₅, который представляет собой своеобразный диффузионный барьер для кислорода. При этом на границе со сплавом падает парциальное давление кислорода и появляются NbO₂ и Ni₃Nb.

При высоких температурах (900-1000°) интенсифицируется окисление никеля до NiO, отчего растет толщина внешнего слоя (NiO+ +NiO·Nb₂O₅) и увеличивается его объемная доля в окалине. Это подтверждают рентгенограммы, снятые с отколотой и растертой в порошок окалины. Так, с увеличением температуры от 900 до 1000° ($\tau = 10$ ч), когда окисляемость сплава увеличивается вдвое [3], на этих рентгенограммах интенсивность линий Ni и β-Nb₂O₅ уменьшается от средней к слабой, а интенсивность NiO и NiO·Nb₂O₅ увеличивается от средней к сильной. Аналогичное изменение рентгеновской картины наблюдается и с увеличением времени высокотемпературного (1000°) окисления. Интенсивное образование зерен NiO с ростом температуры определяется возрастанием коэффициента самодиффузии никеля в NiO [10]. Кроме того, растворение Nb⁺⁵ в NiO приводит к возрастанию в решетке моноокиси никеля числа катионных вакансий, что в свою очередь облегчает диффузию Ni+2 к границе окалина — газ и способствует образованию и росту самостоятельного наружного слоя NiO.

- Duerden I. J., Hume-Rothery W. The equilibrium diagram of the niobium ni-cel.— J. Less Common Metals, 1966, 11, N 6, р. 381—387.
 Крипякевич П. И., Гладышевский Е. И., Пылаева Е. Н. Сосдинения типа W₆Fe₇ в системах Та Ni и Nb Ni.— Кристаллография, 1962, 7, вып. 2, с. 212—216.
 Чуприна В. Г. Изучение книстики окисления соединения NiNb.— Укр. хим. журн., 1984 47, № 2, 247, 250.
- 1981, 47, № 3, с. 247—250.
 4. Чуприна В. Г. Рептгенографическое изучение продуктов окисления Ni₃Nb.— Там же, 1978, 43, № 2, с. 174—178.
- 5. Index to the X-ray powder data filme copyrigt by the american society for testing materials, 1972 (Index Card 9-235). 6. Михеев В. И. Рентгенографический определитель минералов.— М.: Геолтехиздат,
- 1957.—600 c.
- 7. Пылаева Е. Н., Гладышевский Е. И., Крипякевич П. И. Кристаллическая структура соединений Ni₃Nb и Ni₃Ta.-- Журп. неорган. химин, 1958, 3, вып. 7, с. 1626--1631.

- Кофстад П. Отклонение от стехнометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов. М. : Мир. 400 с.

Институт проблем материаловедения АН УССР, Киев

Поступила 11.01.83